

# 技術移転経路として FDI・模倣の両方を考慮したプロダクトサイクルモデル における途上国 IPR 保護強化分析

大木一慶

## 概要

本研究では先進国から途上国への技術伝播経路として直接投資と模倣の両方を考慮するプロダクトサイクルモデルを構築し、途上国の知的所有権（IPR）保護強化による影響を分析する。多くの先行研究では技術伝播経路が海外直接投資もしくは模倣の片方だけに限定されており、前者のモデルでは IPR 保護強化が技術移転を促進し・成長率を引き上げ・先進国途上国間の賃金格差を縮小するが、後者のモデルでは IPR 保護強化が技術移転を抑制し・成長率を引き下げ・先進国途上国間の賃金格差を拡大するといった具合に、技術伝播経路の設定によって導出される結果が正反対となっている。直接投資と模倣の両方を技術移転経路とした本研究では、技術移転費用が無い場合、IPR 保護強化によって模倣による技術移転は減少する一方で FDI による技術移転が増加する効果が常に上回ることで、成長率を引き上げ、先進国途上国間の賃金格差を縮小することを示した。その一方で技術移転費用が十分に大きい場合（途上国だけの資源を必要とする場合においても）、IPR 保護強化によって先進国途上国間の賃金格差は縮小するが、技術移転は減少し、成長率は低下することを示した。

JEL classification:F23,O11,O3